

会社概要

社名	エビナ電化工業株式会社
代表	海老名 伸哉 
社員数	100名
設立	1946年(昭和21年)11月15日
資本金	10,000,000円
事業内容	電気めっき及び無電解めっき
取引銀行	三菱東京UFJ銀行 蒲田駅前支店 三菱東京UFJ銀行 羽田支店
事業所	本社(第1テック、第2テック) 〒144-0033 東京都大田区東糀谷5-22-13 テクノマーク 〒144-0034 東京都大田区西糀谷3-7-22
工場規模	本社・第1テック 敷地 2,654m ² 建物 2,808m ² 第2テック 敷地 777m ² 建物 1,546m ² テクノマーク 敷地 714m ² 建物 927m ²



本社(第1テック)



本社(第2テック)



テクノマーク

最先端ラボとデジタル管理生産システムに 支えられた量産ライン

最先端ラボと生産現場をLANで直結し、品質・量産の安定化とスピード化を図っております。

試作開発の拠点・新テクノロジーセンター

最先端の分析機器とラボラトリーを駆使した試作開発を進めております。

めっき専門の研究開発拠点

最先端の解析機器を使用し、次世代技術を開拓します。

会社沿革

1946年	海老名鍍金工場を創業
1953年	社名をエビナ電化工業株式会社とする
1960年	オートバイのバックミラーへのトリニッケルめっき、水洗金具へのWニッケルめっきを手がける
1981年	プラスチックへの装飾めっきの営業を始める
1985年	アルミセラミックスへのめっきプロセスを開発、量産体制を整える
1986年	電磁波シールドめっきの工業化に成功
1999年	セラミックス基板へのパターンめっきライン増設 ISO9001を取得
2000年	ISO14001を取得
2002年	世界初のめっき専門の研究開発拠点「テクノマーク」を建設
2006年	経済産業省 中小企業庁「元気なモノ作り中小企業300社」に選定
2008年	安倍晋三 前首相が来訪
2009年	複写機の定着ベルトの全自動めっきラインを導入 TV番組「カンブリア宮殿」に出演
2010年	菅直人首相が来訪 試作開発の拠点新テクノロジーセンター「第2テック」竣工
2012年	新黒色めっき「凄黒(すごくろ)」を開発 水質浄化除菌システムAGXXの事業を開始
2013年	受託分析事業(Analysis and Reserch Integrated Service)を開始 3LM (3 Laser Metalization)事業を開始
2015年	経済産業省「ダイバーシティ経営企業100選」に選定



表面処理の種類

電気めっき

漆黑(すごくろ)
AGXX(エー・ジー・ダブル・エックス)
銅めっき(無光沢・半光沢・光沢)
ニッケルめっき(無光沢・半光沢・光沢)
金めっき
銀めっき
白金めっき
ニッケル-鉄めっき
...

無電解めっき

タフブラック
クリスタルブラック
無電解銅めっき
無電解ニッケル-リンめっき
無電解ニッケル-ホウ素めっき
無電解金めっき
...

複合めっき

PTFE複合ニッケルめっき
...

レーザー+めっき

3LM(スリー・エルム)

陽極酸化

チタンの陽極酸化
アルミニウムの陽極酸化

めっき対象素材

金属

ステンレス
鉄/同合金
アルミニウム/同合金
銅/同合金
ニッケル/同合金
チタン/同合金
...

プラスチック

ABS
PC/ABS
PPS
PI
エポキシ樹脂
LCP
...

セラミックス

アルミナ
窒化アルミニウム
PZT
SiC
石英ガラス
...

複合材

AlSiC
AlC
CuC
MgSiC
CFRP
GFRP
...

分析・解析装置

表面分析・解析

走査型電子顕微鏡(SEM)
フィールドエミッション走査型電子顕微鏡(FE-SEM)
デジタルマイクロスコープ
カラーレーザー顕微鏡
エネルギー分散型X線分析装置(EDS)
...

液分析

原子吸光分析装置(AAS)
ICP発光分析装置
高性能キャピラリー電気泳動分析装置(HPCE)
...

試験・評価

蛍光X線式膜厚計
引張強度試験機
超微小押し込み硬度計
分光光度計
冷熱衝撃試験機
...

